

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ C07C 271/20	(11) 공개번호 특 1996-0010617	(43) 공개일자 1996년 04월 20일
(21) 출원번호 특 1994-0022798	(22) 출원일자 1994년 09월 09일	
(71) 출원인 주식회사 유공 조규향	(72) 발명자 서울특별시 영등포구 여의도동 26-4 (우 : 150-010) 변재국 서울특별시 서초구 반포동 효성빌라 4동 102호 최용문 미합중국 07082 뉴저지주 토와코 밴두인시티.2 이철, 염승운	
(74) 대리인 이철, 염승운		

심사청구 : 없음

(54) 신규한 페닐알킬아미노 카바메이트 화합물과 그의 제조방법

요약

본 발명은 중추신경계 치료제로서 유용한 페닐알킬아미노 카바메이트 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 좀 더 상세하게는 특히 항우울제 및 항불안제로서 유용한 *o*-카바모일 페닐알라니놀 라세미체와 그의 순수한 *D*- 및 *L*-광학이성질체, 이들의 약제학적으로 유용한 염 및 이들을 제조하는 방법에 관한 것이다.

명세서

[발명의 명칭]

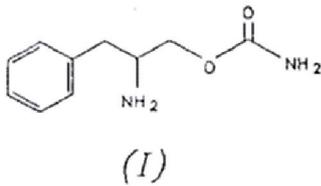
신규한 페닐알킬아미노 카바메이트 화합물과 그의 제조방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

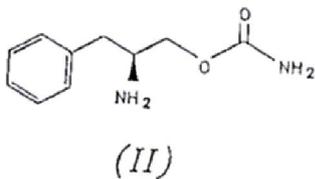
청구항 1

하기 구조식 (I)로 표시되는 *o*-카바모일-(*D*/*L*)-페닐알라니놀 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염.



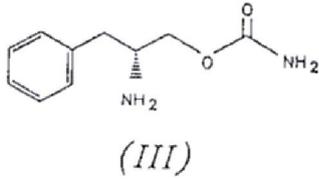
청구항 2

하기 구조식 (II)로 표시되는 *o*-카바모일-(*D*)-페닐알라니놀 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염.



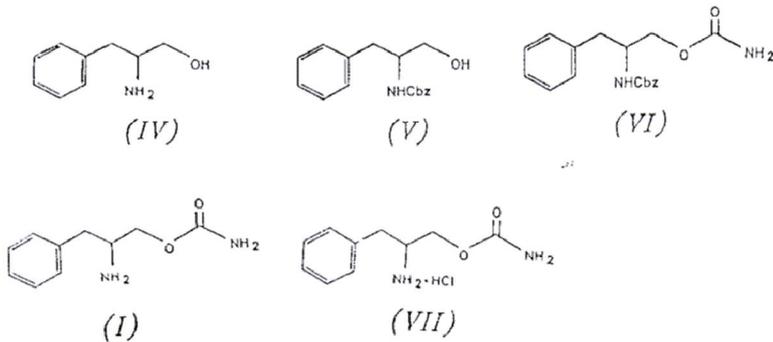
청구항 3

하기 구조식(III)으로 표시되는 0-카바모일-(D)-페닐알라니놀 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염.



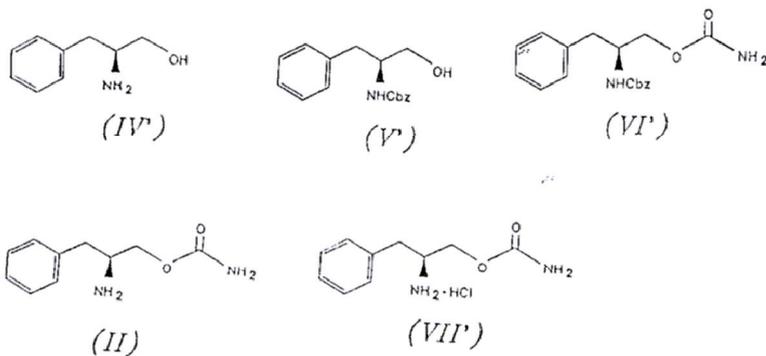
청구항 4

하기 구조식(IV)로 표시되는 (D/L)-페닐알라니놀을 클로로포말산 벤질에스터와 염기성 수용액하에서 반응시켜 하기 구조식(V)로 표시되는 N-벤질옥시카보닐-(D/L)-페닐알라니놀을 합성하고, 이를 포스겐과 반응시킨 후 암모니아 수용액을 처리하여 하기 구조식(VI)로 표시되는 0-카바모일-N-벤질옥시카보닐-(D/L)-페닐알라니놀을 제조한 후, 이 (VII)화합물의 질소보호그룹인 벤질옥시카보닐을 수소화 반응에 의하여 제거하여 하기 구조식(I)로 표시되는 0-카바모일-(D/L)-페닐알라니놀을 제조하고, 무수염산으로 에테르 용액하에서 처리하여 하기 구조식(VII)로 표시되는 0-카바모일-(D/L)-페닐알라니놀 염산염을 제조하는 것을 특징으로 하는 하기 구조식(I)로 표시되는 0-카바모일-(D/L)-페닐알라니놀 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염의 제조방법.



청구항 5

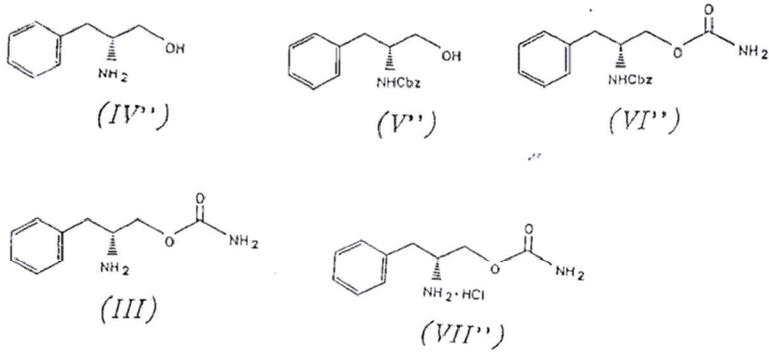
하기 구조식(IV')로 표시되는 (D)-페닐알라니놀을 클로로포말산 벤질에스터와 염기성 수용액하에서 반응시켜 하기 구조식(V')로 표시되는 N-벤질옥시카보닐-(D)-페닐알라니놀을 합성하고, 이를 포스겐과 반응시킨 후 암모니아 수용액으로 처리하여 하기 구조식(VI')로 표시되는 0-카바모일-(D)-페닐알라니놀을 제조한 후, 이 (VI')화합물의 질소보호그룹인 벤질옥시카보닐을 수소화 반응에 의하여 제거하여 하기 구조식(II)로 표시되는 0-카바모일-(D)-페닐알라니놀을 제조하고, 무수염산으로 에테르 용액하에서 처리하여 하기 구조식(VII')로 표시되는 0-카바모일-(D)-페닐알라니놀 염산염을 제조하는 것을 특징으로 하는 하기 구조식(II)로 표시되는 0-카바모일-(D)-페닐알라니놀 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염의 제조방법.



청구항 6

하기 구조식(IV'')로 표시되는 (L)-페닐알라니놀을 클로로포말산 벤질에스터와 염기성 수용액하에서 반응시켜 하기 구조식(V'')로 표시되는 N-벤질옥시카보닐-(L)-페닐알라니놀을 합성하고, 이를 포스겐과 반응시킨 후 암모니아 수용액으로 처리하여 하기 구조식(VI'')로 표시되는 0-카바모일-N-벤질옥시카보닐-(L)-페닐알라니놀을 제조한 후, 이 (VI'')화합물의 질소보호그룹인 벤질옥시카보닐을 수소화반응에 의하여 제거하여 하기 구조식(III)으로 표시되는 0-카바모일-(L)-페닐알라니놀을 제조하고, 무수염산으로 에테르 용액하에서 처리하여 하기 구조식(VII'')로 표시되는 0-카바모일-(L)-

페닐알라니놀 염산염을 제조하는 것을 특징으로 하는 하기 구조식(III)으로 표시되는 0-카바모일-(L)-페닐알라니놀 화합물과 그의 약제학적으로 유용한 염의 제조방법.



※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.